

10/505219

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局(43) 国際公開日  
2003年8月28日 (28.08.2003)

PCT

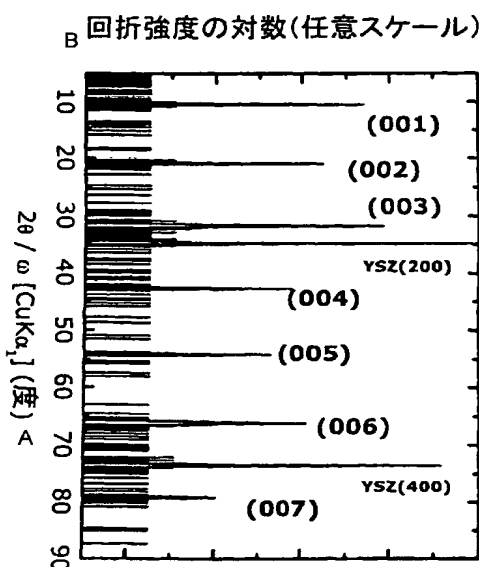
(10) 国際公開番号  
WO 03/071595 A1

- (51) 国際特許分類: H01L 21/363, 33/00, C30B 29/22
- (21) 国際出願番号: PCT/JP03/01756
- (22) 国際出願日: 2003年2月19日 (19.02.2003)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願2002-45417 2002年2月21日 (21.02.2002) JP  
特願2002-197744 2002年7月5日 (05.07.2002) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 科学技術振興事業団 (JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY CORPORATION) [JP/JP]; 〒332-0012 埼玉県 川口市 本町4-1-8 Saitama (JP).
- (71) 出願人 および  
(72) 発明者: 太田 裕道 (OTA, Hiromichi) [JP/JP]; 〒213-0022 神奈川県 川崎市 高津区 千年1-18-4 グランドールB-202 Kanagawa (JP). 折田 政寛 (ORITA, Masahiro) [JP/JP]; 〒274-0072 千葉県 船橋市 三山5-7-9 Chiba (JP).
- (72) 発明者; および  
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 細野 秀雄 (HOSONO, Hideo) [JP/JP]; 〒242-0001 神奈川県 大和市 下鶴間2-7-8 6-4-2 12 Kanagawa (JP). 平野 正浩 (HIRANO, Masahiro) [JP/JP]; 〒156-0043 東京都 世田谷区 松原5-5-6 Tokyo (JP). 平松 秀典 (HIRAMATSU, Hidenori) [JP/JP]; 〒211-0044 神奈川県 川崎市 中原区 新城5-9-16 エクセルスリー101 Kanagawa (JP). 植田 和茂 (UEDA, Kazushige) [JP/JP]; 〒228-0811 神奈川県 相模原市 東林間8-9-6 グリーンコア201 Kanagawa (JP).
- (74) 代理人: 西 義之 (NISHI, Yoshiyuki); 〒235-0036 神奈川県 横浜市 磯子区 中原4-2-6 32-2 11 西特許事務所 Kanagawa (JP).

[続葉有]

(54) Title: LnCuO(S, Se, Te) MONOCRYSTALLINE THIN FILM, ITS MANUFACTURING METHOD, AND OPTICAL DEVICE OR ELECTRONIC DEVICE USING THE MONOCRYSTALLINE THIN FILM

(54) 発明の名称: LnCuO(S, Se, Te)単結晶薄膜とその製造方法、及び該単結晶薄膜を用いた光デバイス又は電子デバイス



A...(DEGREE)  
B...LOGARITHM OF DIFFRACTION INTENSITY (ARBITRARY SCALE)

(57) Abstract: Conventional LnCuOX films are manufactured by growing an amorphous film under adequate conditions by sputtering and annealing the film at high temperatures. They are all polycrystalline and do not contribute to high emission efficiency and electron mobility when used as a material of a light-emitting device or an electronic device. A base thin film is grown on a monocrystalline substrate. An amorphous or polycrystalline LnCuOX (where Ln is at least one element out of Lanthanide series and Y, and X is at least one element out of S, Se, and Te) thin film is deposited on the base thin film. The substrate is annealed at a high temperature of 500°C or more. Thus, a thin film of good crystallinity suitable for a single crystal for a light-emitting diode device, a semiconductor laser device, a field-effect transistor device, or a heterobipolar transistor device.

[続葉有]

BEST AVAILABLE COPY

WO 03/071595 A1



(81) 指定国 (国内): US.

添付公開書類:  
— 国際調査報告書

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

従来のLnCuOX膜は、スパッタリング法により、適切な条件でアモルファス膜を成長させ、その後高温でアニールすることによって製造されていたが、すべて多結晶であり、発光素子、電子素子材料として十分に高い発光効率、電子移動度を示していなかった。

単結晶基板上に基材薄膜を成長させ、さらにその上に、アモルファスまたは多結晶LnCuOX(ただし、Lnは、ランタノイド元素またはYのうち少なくとも1種類、また、Xは、S、Se、またはTeのうち少なくとも1種類を意味する。)薄膜を堆積させた後、500℃以上の高温でアニールする。発光ダイオード素子、半導体レーザー素子、電界効果型トランジスタ素子、またはヘテロバイポーラトランジスタ素子用単結晶として適する結晶性の良い薄膜を成長させることができる。

## 明 細 書

- 1 LnCuO(S, Se, Te)単結晶薄膜とその製造方法、及び該単結晶薄膜を用いた光デバイス又は電子デバイス

## 技術分野

- 5 本発明は、LnCuO(S, Se, Te)（ただし、Lnは、ランタノイド元素又はYのうち少なくとも1種類を意味する。）単結晶薄膜の製造方法、該製造方法で得られた単結晶薄膜、及び該単結晶薄膜を用いた光デバイス又は電子デバイスに関する。

## 背景技術

- 10 (気相エピタキシャル膜の製造方法)

気相エピタキシャル成長とは、真空中で単結晶の基板上に蒸着膜を成長させ、基板結晶の規則的な原子配列の影響を反映して、基板結晶方位と蒸着膜の結晶方位が決まった関係で成長することを指す。エピタキシャル成長技術として代表的な薄膜成長技術は、スパッタリング法、化学気相蒸着(CVD)法、分子線エピタキシー(MBE)法、パルスレーザー蒸着(PLD)法などである。

- 15 非熱平衡蒸発を用いるスパッタリング法は、現在最も広く普及し、工業的にも活用されている手法である。成膜法としてのスパッタリング法は1852年にW. Groveが発見したスパッタ現象を利用した方法である。スパッタ現象とは、ターゲット表面に入射する高運動エネルギー粒子(イオン又はターゲット表面近傍で電子により中性化された原子)が弾性衝突によりターゲット構成原子にその運動
- 20

1 量を与え、反跳原子は近傍の原子と次々と衝突を繰り返し、結果として、ターゲット表面原子が放出されることを指す。スパッタリング法による製膜法は、放出されたターゲット構成原子を基板上に堆積させ薄膜化するものである。

5 化学気相蒸着(CVD、Chemical Vapor Deposition)法は、塩化物あるいは有機金属化合物を原料にして、基板上で原料ガスを化学反応させ、所望の組成を有する薄膜を基板上に育成する方法であり、量産性に優れているため、半導体レーザーなどの実用材料に広く使われている。

分子線エピタキシー(MBE、Molecular Beam Epitaxy)法は、1968年当時に米国ベル研究所にいた、J. R. Arthurにより命名された技術であり、主に、GaAs等  
10 の化合物半導体を対象に開発された薄膜結晶成長法である。MBE法は、真空蒸着法の改良・発展形とみなすことが出来る。

これは、超高真空中で、成長させようとする結晶の原材料の中性分子(又は原子)の流れ、すなわち分子線(原子線)の強度を精度よく制御し、これを精度よく加熱した基板上に入射させることによりエピタキシャル結晶成長を行わせる方法  
15 である。MBE法で取り扱うことのできる材料の種類は、化合物半導体、Siなどの元素半導体、さらには、各種の金属超伝導体、酸化物超伝導体と多岐に亘る。通常の真空蒸着法との違いは、成長室内の真空度が $10^{-7} \sim 10^{-8}$ Pa以下であり、結晶の表面が原子スケールで常に清浄に保たれた状態で成長が行われ、分子線の強度が精度よく制御されていることである。

20 パルスレーザー蒸着(PLD、Pulsed Lasered Deposition)法は、1960年のルビーレーザーの発振からまもなく研究開発され始めた手法で、実際は1980年代後半からエキシマレーザーを利用し、高温超伝導体、誘電体、有機高分子など

1 の単結晶薄膜製造方法として応用されてきた。

レーザアブレーションとは、レーザ光を固体に照射した場合、レーザ光の照射強度があるしきい値以上になると、固体表面で、電子的、熱的、光化学的及び力学的エネルギーに変換され、その結果、様々な種類のフラグメント(中性原子、分子、正負イオン、ラジカル、クラスタなど)が爆発的に放出され、固体表面がエッチングされるプロセスのことをいう。

PLD法とは、このレーザアブレーションの原理を利用して、成長室内の真空度が $10^{-7} \sim 10^{-8}$  Pa以下の超高真空雰囲気下、又は反応性ガスをフローさせることにより充分制御された雰囲気下で、基板上に固体の単結晶薄膜を製造する方法である。PLD法の特徴は、同じ非熱平衡蒸着プロセスを用いるスパッタリング法と異なり、ターゲットの組成と得られる膜の組成ずれが少ないこと、ターゲット交換という非常に簡単な手法で様々な物質の単結晶薄膜の製造が可能であることなどが挙げられる。その特長を生かし、近年では、特に物質探索を行う研究分野で積極的に利用されている成膜方法である。

1 5

#### 発明の開示

本発明は、固相エピタキシャル法を用いて $\text{LnCuOX}$ (ただし、Lnは、ランタノイド元素又はYのうち少なくとも1種類、また、Xは、S、Se、又はTeのうち少なくとも1種類を意味する。)エピタキシャル単結晶薄膜成長を実現する手法の開発を目的とする。 $\text{LnCuOX}$ はその多結晶膜においても励起子由来の発光が確認され、発光材料としては非常に有望であり、単結晶薄膜を得ることができれば次世代の紫外発光デバイス材料として利用することができる。しかしながら、 $\text{LnCuOX}$ は、その構

2 0

1 成元素が蒸気圧の高いCu化合物及びX成分を含むものであり、真空雰囲気を利用した成膜方法を用いた場合、Cu及びX成分の組成ずれが大きく、単一相を得ることさえ困難である。

また、 $\text{LnCuOX}$ はワイドギャップp型半導体である。一般的に、 $\text{ZnO}$ 、 $\text{SnO}_2$ など殆どのワイドギャップ物質はSiのようなバイポーラ物質ではなく、メインキャリアを電子とするn型半導体である。したがって、それらでFET(電界効果トランジスタ、Field Effect Transistor)構造を形成した場合のゲート電圧は正となる。しかしながら、ワイドギャップp型半導体である $\text{LnCuOX}$ によって同様のFET構造を構築すればそのゲート電圧は負で動作するため、前述のn型ワイドギャップ半導体FETと組み合わせることによってワイドギャップCMOS回路(Complimentary-MOS)、すなわち、高性能の透明電子回路の製造が可能となる。同様に、n型半導体と組み合わせることによってpn接合を用いたヘテロバイポーラトランジスタ又は発光ダイオードの製造も可能である。

( $\text{LnCuOX}$ に関して)

1 5 1981年、Palazziによって層状構造からなるオキシサルファイド $\text{LaCuOS}$ の存在が初めて報告された(M. Palazzi, Acad. Sci. Paris C. R. 292, 789(1981))。 $\text{LaCuOS}$ の結晶系は正方晶系であり、空間群はNo. 129、 $P4/nmm$ をとる。 $Z=2$ であり、格子定数は $a=3.999 \text{ \AA}$ 、 $c=8.53 \text{ \AA}$ である。 $(\text{La}_2\text{O}_2)^{2+}$ 相と $(\text{Cu}_2\text{S}_2)^{2-}$ 相がそのc軸に沿って交互に積層した層状構造を有している。

2 0 2000年、K. Uedaらによって、 $\text{LaCuOS}$ は、バンドギャップ約3.1 eVの透明p型半導体であることが初めて報告され、次世代のワイドギャップp型半導体材料として有望であることが示唆された(K. Ueda, S. Inoue, S. Hirose, H. Kawazoe and

1 H. Hosono, Appl. Phys. Lett., 77, 2701 (2000))。

2 0 0 1 年、K. Uedaらによって、LaCuOSは、室温においても安定な励起子由来  
の吸収、及び発光特性を有しており、次世代の紫外発光素子材料として有望であ  
ることが報告された (K. Ueda, S. Inoue, H. Hosono, N. Sarukura and M. Hirano, Appl  
5 . Phys. Lett., 78, 2333 (2001))。

このLaCuOSのLaサイトをその他のランタノイド元素と置換した場合、又はSサ  
イトをSe、Teのカルコゲン元素と置換した場合でも同じ結晶構造を有することが  
知られており、同様の手法によって合成が可能であることが報告されている (D. O.  
Charkin, A. V. Akopyan and V. A. Dolgikh, Russian J. Inorg. Chem., 44, 833 (1999))。  
1 0 したがって、全てのLnCuOXに関して同じ手法で単結晶薄膜成長ができる。

(Laサイトの $M^{2+}$ 置換体)

LnサイトをSr及びCaの2価のアルカリ土類金属イオンで置換することによってL  
nCuOXの電気伝導度が約  $10^2$  S/cmまで増加することが知られている (K. Ishikawa,  
S. Kinoshita, Y. Suzuki, S. Matsuura, T. Takanishi, M. Aizawa, and Y. Suzuki, J. Elec  
1 5 trochem. Soc. 138, 1166 (1991)、及び Y. Takano, K. Yahagi, and K. Sekizawa, Physic  
a A 206&207, 764 (1995))。また、多結晶薄膜においてもLaサイトをSrで置換する  
ことによって  $6.4 \times 10^{-5}$  S/cmから 20 S/cmまでその電気伝導度は増加し、最大ホー  
ル濃度は  $2.7 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$  にまで達することが報告されている (参考文献: H. Hiramatsu,  
M. Orita, M. Hirano, K. Ueda, and H. Hosono, J. Appl. Phys. 91, 9177 (2002))。

2 0 (LaCuOSとLaCuOSe固溶体について)

LaCuOSとそのSサイトをSeで置換したLaCuOSeは互いに全率固溶の関係にあり、  
LaCuOS<sub>1-x</sub>Se<sub>x</sub> ( $0 < x < 1$ ) という固溶体が存在する (K. Ueda and H. Hosono, Thin Solid

1 Films, 411, 115 (2002))。置換量 $x$ の値を0から1へ変化させることによって、その  
バンドギャップを3.1eVから2.8eVまで連続的にコントロールできることが知られ  
ている (K. Ueda, H. Hosono, J. Appl. Phys. 91, 4768 (2002))。したがって、置換量 $x$ と  
その厚みを厳密に制御すれば発光波長を制御できるばかりか、量子井戸構造を構  
5 築することも可能となる。

(従来のLnCuOX膜の製造方法及びその問題点)

LnCuOXはワイドギャップp型半導体であり、紫外発光素子の活性層として期待  
されている材料であるが、単結晶薄膜の製造は極めて困難であった。従来、LnCu  
OX薄膜は、スパッタリング法により、適切な条件でアモルファス膜を成長させ、  
10 その後高温でアニールすることによって製造されていた (K. Ueda, S. Inoue, S. Hiro  
se, H. Kawazoe and H. Hosono, Appl. Phys. Lett. 77, 2701 (2000))。

しかしながら、このような方法で製造される膜はすべて多結晶であり、発光素  
子、電子素子材料として十分に高い発光効率、電子移動度を示していなかった。  
したがって、発光材料として、又はp型伝導性半導体として実用化するためには、  
15 結晶性の良い薄膜を成長させる有効な単結晶製造方法の開発が切望されていた。

本発明では、こうした問題を解決するために、まず、基材薄膜を単結晶基板上  
に成長させ、該基材薄膜上に、アモルファス、又は多結晶LnCuOX(ただし、Lnは、  
ランタノイド元素又はYのうち少なくとも1種類、また、Xは、S、Se、又はTeのう  
ち少なくとも1種類を意味する)を堆積させ、それを真空封入下で500℃以上の  
20 高温でアニールすることによりLnCuOX単結晶薄膜を成長することを特徴とするLn  
CuOX単結晶薄膜の製造方法である。

本発明のLnCuOX単結晶薄膜は、基材となる薄膜上に一旦形成されるが、基材薄



1 膜として、Cu、Cu<sub>2</sub>S、CuS、Cu<sub>2</sub>O、CuO、CuCl、CuCl<sub>2</sub>、又はCuI膜を用いた場合、  
該基材成分のうちのCu、O、又はSはLnCuOX中に混入し、また、Cl、Iは蒸発するた  
め消失し、基材薄膜を成長させたYSZ、Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、STO、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、MgOいずれかの単結晶  
基板上に、直接LnCuOXがエピタキシャル成長した状態になる。

5 基材薄膜として、Cu、Cu<sub>2</sub>S、CuS、Cu<sub>2</sub>O、CuO、CuCl、CuCl<sub>2</sub>、又はCuI膜以外の  
Ag、Ag<sub>2</sub>S、Ag<sub>2</sub>O、AgO、AgCl、AgIなどのAg化合物、又はAuを用いた場合、これら  
の薄膜成分はLnCuOXと未反応のままYSZ、Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、STO、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、MgOいずれかの単結  
晶基板上にそのまま残るか、一部LnCuOX内に拡散し不純物として残留する。

本発明の方法においては、加熱処理中にCu及びX成分の蒸発を抑制するため、

1 0 LnCuOX/基材薄膜/単結晶基板の積層膜を真空封入された状態でアニールする。

こうして製造されたLnCuOX単結晶膜は、室温で励起子による発光効率が低いこ  
とを利用して紫外発光デバイス(ダイオード、レーザー)の活性層として用いるこ  
とが可能である。こうして製造されたLnCuOX単結晶膜は、電界効果型トランジス  
タ素子(FET)構造を構築することにより、ゲート電圧が負で動作する透明FETの作

1 5 製が可能であり、n型半導体と組み合わせることによってCMOS回路及びヘテロバイ  
ポーラ素子の製造が可能である。

#### 図面の簡単な説明

第1図は、実施例1で製造したLnCuOX単結晶薄膜の結晶性をOut-of-plane XRD  
2 0 パターンで示すグラフである。第2図は、実施例1で製造したLnCuOX単結晶薄膜  
の10Kから300Kにおける光吸収スペクトルを示すグラフである。第3図は、実施例  
1で製造したLnCuOX単結晶薄膜の10Kから300Kにおける発光スペクトルを示すグラ

1 フである。第4図は、実施例2で製造した $\text{LnCuOX}$ 単結晶薄膜の結晶性をOut-of-plane XRDパターンで示すグラフである。第5図は、実施例3で製造した $\text{LaCuOSi}_{1-x}\text{Se}_x$  ( $x=0, 0.25, 0.4, 0.7, 1.0$ )のOut-of-plane XRDパターンである。第6図は、実施例3で製造した $\text{LaCuOSi}_{1-x}\text{Se}_x$  ( $x=0, 0.25, 0.4, 1.0$ )の10Kでの発光スペクトルである。  
5 る。第7図は、実施例4で製造した単結晶 $\text{LnCuOXX'}$ 固溶体薄膜の結晶性をOut-of-plane XRDパターンで示すグラフである。第8図は、比較例1で製造した $\text{LnCuOX}$ 膜の結晶相をOut-of-plane XRDパターンで示すグラフである。第9図は、比較例2で製造した $\text{LnCuOX}$ 膜とCu基材薄膜を用いた場合の $\text{LnCuOX}$ 薄膜の結晶性をOut-of-plane XRDパターンで比較した結果を示すグラフである。

#### 10 発明を実施するための最良の形態

本発明の $\text{LnCuOX}$ 単結晶薄膜の製造方法において、基材薄膜の成長には、スパッタリング法、CVD法、MBE法、PLD法などの成膜法を適宜使用できる。単結晶基板としては、YSZ、 $\text{Y}_2\text{O}_3$ 、STO、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、又は $\text{MgO}$ などを使用できるが、特に、YSZ(10  
15 0)、 $\text{Y}_2\text{O}_3$ (100)、又は $\text{MgO}$ (100)単結晶は、 $1200^\circ\text{C}$ 以下の高温においても $\text{LnCuOX}$ 化合物と化学反応することがなく、単結晶基板として好ましい。

基板結晶面内の最近接アニオン間距離(A基板)が、 $\text{LnCuOX}$ のC面内の最近接アニオン間距離(A膜)に近い結晶基板、すなわち格子間距離不整合の少ない結晶基板が好ましい。例えば、 $\text{LaCuOS}$ では、 $A_{\text{膜}}=2.82$ 、 $\text{LaCuOSe}$ では、 $A_{\text{膜}}=2.88$ で  
20 あり、 $\text{MgO}$ (100)では、 $A_{\text{基板}}=2.96$ 、YSZ(100)では、 $A_{\text{基板}}=2.58$ 、 $\text{Y}_2\text{O}_3$ (100)では、 $A_{\text{基板}}=2.92$ である。したがって、 $\text{LaCuOS} \cdot \text{Se}$ 単結晶薄膜成長に対しては、格子間距離整合の観点から、 $\text{Y}_2\text{O}_3$ 、 $\text{MgO}$ 、YSZの順で、結晶基板としてより好まし

1 い。

成膜工程としては、まず、YSZ、 $Y_2O_3$ 、 $MgO$ などの単結晶基板上に、 $Cu$ 、 $Cu_2S$ 、 $CuS$ 、 $Cu_2O$ 、 $CuO$ 、 $CuCl$ 、 $CuCl_2$ 、 $CuI$ 、 $Ag$ 、 $Ag_2S$ 、 $Ag_2O$ 、 $AgO$ 、 $AgCl$ 、 $AgI$ 、 $Au$ のいずれかの基材薄膜を成長させる。基材薄膜として $Cu$ 又は $Cu$ 系化合物を用いた場合は、  
5  $Cu$ 、 $O$ 、 $S$ 成分はその上に堆積される $LnCuOX$ 薄膜中に混入する。しかし、 $Cu$ 及び $Cu$ 系化合物以外の場合、基材薄膜成分は、単結晶基板と $LnCuOX$ との界面に残留するだけでなく、一部は $LnCuOX$ 膜中に拡散する。

該基材薄膜上に、 $LnCuOX$ 焼結体をターゲットとして、 $LnCuOS$ の場合には $H_2S$ 雰囲気下で、 $LnCuOSe$ 及び $LnCuOTe$ の場合には、アルゴン又は、真空雰囲気下で $LnCu$   
10  $OX$ 薄膜を堆積させる。堆積方法は、スパッタリング法及びPLD法が簡便であり好ましいが、この手法に限られるものではない。基材上に堆積させる $LnCuOX$ 膜は、多結晶膜でもアモルファスでもよい。

$LnCuOX_{1-x}X'_x$  ( $X$ と $X'$  は、 $S$ 、 $Se$ 、又は $Te$ のうち少なくとも1種類を意味し、 $X$ と $X'$  は異なる元素、 $0 < x < 1$ ) 固溶体焼結体をターゲットとして、固溶体膜を堆積させてもよい。この場合は、最終的に該固溶体組成の単結晶膜が得られる。異なる $Ln$   
15 又は $X$ を含むターゲットを用い、異なる組成を有する膜を多層に堆積してもよい。この場合にも、最終的には、すべての膜組成を膜厚で重み付けした平均化組成を有する固溶体単結晶膜が得られる。

固溶体は、 $x$  値を制御することにより、連続的に、発光波長を変化させることができるので、発光材料として利用するときには有用である。また、 $x$  値により、  
20 禁制帯エネルギー幅も連続的に変化するので、異なる  $x$  値の単結晶膜を交互に積層することにより、人工超格子構造を作製することができる。

- 1 得られたLnCuOX／基材薄膜／単結晶基板の積層膜を真空封入し、500℃以上、好ましくは1000℃以上の温度で加熱処理を行う。500℃未満では拡散が不十分なため均一な単結晶LnCuOX薄膜が得られない。また、加熱温度が1200℃程度以上になると単結晶基板とLnCuOX化合物が反応するため、また、石英ガラスが軟化して、封入管として使用できなくなるので好ましくない。

- 5 Cu及びX成分は、その蒸気圧が高いため、真空下で高温でアニールすると、処理中に該LnCuOX薄膜から、Cu、X成分が蒸発し、加熱処理後に得られる薄膜組成が大幅に変化してしまい、良質なLnCuOX単結晶が得られないことがある。Cu、X成分の蒸発を抑制するためには、まず、加熱前に該積層膜を真空排気された石英管などの密閉容器中に封入してしまうとよい。

- さらに、ごく僅かなCu、X成分の蒸発を抑制するためには、真空封入された状態で、かつ加熱雰囲気下でCu、X成分の蒸気圧を補償するために、密閉容器中に該単結晶薄膜と同化学式のLnCuOX蒸気を発生させ、LnCuOX蒸気を含む雰囲気でアニールするとよい。たとえば、LnCuOX粉末を密閉容器中に同封することもその方法の1つである。

- 1 5 ただし、そのLnCuOX粉末を用いる場合、加熱中に発生するLnCuOX蒸気が固化し、該単結晶薄膜表面に微粒子が析出して荒れることがある。それを防ぐには、YSZのようなLnCuOX膜と反応性のない基板でLnCuOX膜の表面を覆ってから真空封入するとよい。

- 2 0 さらに、Cu、X成分の蒸発を抑制するためには、2枚のLnCuOX／基材薄膜／単結晶基板の積層膜の表面同士を張り合わせて、真空封入するとよい。2枚を張り合わせる場合、その一方は基材薄膜のないLnCuOX／単結晶基板の積層膜でもよい。

1 この場合は、基材薄膜を堆積した方だけが $\text{LnCuOX}$ 単結晶薄膜となる。

多結晶の場合と同様に、 $\text{Ln}$ サイトを2価の金属イオン $\text{M}$  ( $\text{M}$ は、 $\text{Mg}$ ,  $\text{Ca}$ ,  $\text{Sr}$ ,  $\text{Ba}$ ,  $\text{Zn}$ のうちの少なくとも1種類)で置換することによって、効果的にホールキャリアを生成することも可能となる。この場合、焼結体ターゲット中に2価の金属イオンを含有させることで膜中の $\text{Ln}$ サイトを該金属イオンで置換することができる。5 その置換量をコントロールすることによって $\text{Ln}_{1-y}\text{M}_y\text{CuOX}$  (ただし、 $0 < y < 1$ ) 単結晶薄膜の電気伝導度を $10^{-5}\text{S/cm}$ から $80\text{S/cm}$ まで連続的に制御することができる。

格子間距離不整合が非常に大きな結晶基板と $\text{LnCuOX}$ 薄膜の組合せでは、単結晶膜を育成しにくいことがある。例えば、 $\text{YSZ}(100)$ 基板上に、 $x$ が0.5以上の $\text{LaCuO}$ 10  $\text{Si}_{1-x}\text{Se}_x$ 膜を育成する場合、単結晶膜が得にくい。こうした場合でも、まず、上記手法で、格子間距離不整合の少ない $\text{LnCuOS}$ 薄膜単結晶を $\text{YSZ}(100)$ 基板上に育成し、さらにその上に、 $\text{LnCuOSe}$ 薄膜を堆積させた後、真空封入下で、 $500^\circ\text{C}$ 以上の高温でアニールすることにより、単結晶 $\text{LaCuOSi}_{1-x}\text{Se}_x$ 固溶体単結晶薄膜を得ることができる。すなわち、 $\text{LnCuOX}$ 単結晶薄膜中に、アモルファス又は多結晶状態の $\text{LnCu}$ 15  $\text{OX}'$ を固相拡散させることにより、結晶基板との格子不整合の大きな $\text{LnCuOX}_{1-x}\text{X}'_x$ 単結晶薄膜を育成することができる。この場合、 $\text{Ln}$ のサイトを2価の金属イオン $\text{M}$ で置換してもよい。

固溶体は、 $x$ 値を制御することにより、連続的に、発光波長を変化させることができるので、発光材料として利用するときには有用である。また、 $x$ 値により、20 禁制帯エネルギー幅も連続的に変化するので、異なる $x$ 値の単結晶膜を交互に積層することにより、人工超格子構造を作製することができる。

こうして得られた $\text{LnCuOX}$ 単結晶薄膜又は $\text{Ln}_{1-y}\text{M}_y\text{CuOX}$ 単結晶薄膜は、 $\text{ZnO}$ 、 $\text{ZnS}$ 、

1  $\text{In}_2\text{O}_3$ 、 $\text{SnO}_2$ のいずれかのn型半導体と積層構造を形成することによって発光ダイ  
オードの製造が可能である。

こうして得られた $\text{LnCuOX}$ 単結晶薄膜又は $\text{Ln}_{1-y}\text{M}_y\text{CuOX}$ 単結晶薄膜は、 $\text{ZnO}$ 、 $\text{ZnO}:$   
5  $\text{Mg}$ などとダブルヘテロ構造を構築することによって半導体レーザーの製造が可能  
である。

こうして得られた $\text{LnCuOX}$ 単結晶薄膜又は $\text{Ln}_{1-y}\text{M}_y\text{CuOX}$ 単結晶薄膜は、YSZをゲー  
ト絶縁膜として堆積し、Pt-Pd又はITOをソース、ドレイン電極とすることによっ  
てFETの製造が可能である。

こうして得られた $\text{LnCuOX}$ 単結晶薄膜又は $\text{Ln}_{1-y}\text{M}_y\text{CuOX}$ 単結晶薄膜は、 $\text{ZnO}$ 、 $\text{ZnS}$ 、  
10  $\text{In}_2\text{O}_3$ 、 $\text{SnO}_2$ のいずれかのn型半導体とヘテロ構造を形成し、各表面にオーミック  
電極を形成することによってヘテロバイポーラトランジスタの製造が可能である。

#### 実施例

以下に実施例を挙げて本発明を詳細に説明する。

#### (実施例1)

#### 15 1. Cu薄膜の成長

YSZ(100)単結晶基板(10mm平方×0.5mm厚)上に、基板温度200℃でPLD法によりC  
u薄膜を成長させた。X線反射率及び蛍光X線測定から求めたCu薄膜の厚みは5n  
mであった。成長したCu薄膜の結晶性をHRXRDにより評価したところ、YSZ(100)基  
板上にCuは(111)配向しており、そのチルト角は0.01度であった。

#### 20 2. $\text{LaCuOS}$ /Cu積層薄膜の作製

YSZ(100)基板上に成長したCu薄膜を基材として、基板温度を室温として、パル  
スレーザー蒸着法(PLD法)により、 $\text{LaCuOS}$ 焼結体をターゲットとして $\text{H}_2\text{S}$ 雰囲気下

1 でLaCuOSを堆積させた。X線反射率測定からLaCuOS薄膜の膜厚は200nmであることが分かった。堆積したLaCuOS薄膜はアモルファスであった。

### 3. LaCuOS単結晶薄膜の作製

5 作製したLaCuOS/Cu/YSZ積層膜2枚の表面同士を張り合わせて、蒸気圧の高いCu、S成分の蒸発を抑制するため、LaCuOS粉末(平均粒径約0.1 $\mu$ m, 約0.1g)と一緒に石英ガラス管に真空封入して、該石英ガラス管を大気中、1000°Cで30分間加熱してアニール処理を施した。加熱処理終了後は室温まで炉内で冷却した。

### 4. LaCuOS単結晶薄膜の結晶性

10 作製したLaCuOS単結晶薄膜の結晶性は高分解能X線回折(HRXRD, Rigaku製ATX-G, CuK $\alpha$ 1)を用いて調べた。第1図に、Out-of-plane XRDパターンを示す。LaCuOSの(001)面の強い回折ピークがYSZ(100)ピークとともに観測された。LaCuOS(001)がYSZ(100)上に強く配向していることを示し、ロッキングカーブ測定からLaCuOS(001)面のチルト角は0.1度であった。また、基材薄膜として成長させたCu薄膜の回折は消滅した。作製したLaCuOS薄膜はIn-plane測定からエピタキシャル成長していることが明らかになった。エピタキシャル関係は次の通りである。



### 5. LaCuOS単結晶薄膜の光吸収特性及び発光特性

20 作製したLaCuOS単結晶薄膜をクライオスタット(ダイキン製, 4.2K)に取り付けて、系内を真空排気した後、温度を10Kまで冷却した。第2図に、10K~300Kまでの光吸収スペクトルの温度依存性を示す。励起子由来のシャープな吸収が得られた。第2図中に、比較例として、LaCuOS多結晶の6Kにおける吸収スペクトルを示

した。

発光スペクトルはレンズで集光してバンドルファイバーに導き、分光して電荷結合デバイス(CCD)を用いて検出した。Nd:YAGの4倍波(波長266nm)を薄膜に照射することで励起を行った。第3図に、10K~300Kまでの発光スペクトルの温度依存性を示す。中心波長390nmのシャープな紫外発光が得られた。

(実施例2)

#### 1. Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>単結晶基板の作製

YSZ(100)結晶基板(10mm平方×0.5mm厚)上に、基板温度900℃でPLD法によりY<sub>2</sub>O<sub>3</sub>単結晶薄膜を成長させた。X線反射率から求めたY<sub>2</sub>O<sub>3</sub>薄膜の厚みは35nmであった。作製したY<sub>2</sub>O<sub>3</sub>単結晶薄膜の結晶性をHRXRDにより評価したところ、YSZ(100)基板上にY<sub>2</sub>O<sub>3</sub>は(100)配向しており、そのチルト角は0.5度であった。In-plane測定から作製したY<sub>2</sub>O<sub>3</sub>薄膜はエピタキシャル成長していることが明らかになった。エピタキシャル関係は次の通りである。

$$Y_2O_3(100) // YSZ(100)$$

$$Y_2O_3(010) // YSZ(010)$$

#### 2. Cu/Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/YSZ積層薄膜の作製

実施例1-1と同様の作製法により、Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/YSZ単結晶基板上にCu薄膜を成長させた。成長したCu薄膜の結晶性をHRXRDにより評価したところ、Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(100)/YSZ(100)基板上にCuは(111)配向しており、そのチルト角は0.01度であった。

#### 3. LaCuOS/Cu/Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>積層薄膜の作製

Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/YSZ(100)単結晶基板上に成長したCu薄膜を基材として、基板温度を室温として、パルスレーザー蒸着法(PLD法)により実施例1-2と同じ条件でLaCuOSを



1 堆積させた。X線反射率測定からLaCuOS薄膜の膜厚は200nmであることが分かった。  
作製したLaCuOS薄膜はアモルファスであった。

#### 4. LaCuOS単結晶薄膜の作製

実施例1-3と同様に単結晶LaCuOS薄膜を作製した。

#### 5. LaCuOS単結晶薄膜の結晶性

5 作製した単結晶薄膜の結晶性は高分解能X線回折(HR-XRD, Rigaku製ATX-G, Cu  
K $\alpha$ 1)を用いて調べた。第4図に、Out-of-plane XRDパターンを示す。Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>とCu又  
はLaCuOSは未反応であった。また、基材として成長させたCu薄膜の回折は消滅し  
た。LaCuOSの(001)面の強い回折ピークがY<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(100)及びYSZ(100)ピークとともに  
10 観測された。LaCuOS(001)がY<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(100)上に強く配向していることを示し、ロッキ  
ングカーブ測定からLaCuOS(001)面のチルト角は0.1度であった。

(実施例3)

格子間距離不整合の小さな基板上への単結晶LaCuOS<sub>1-x</sub>Se<sub>x</sub>(0<x<1)固溶体薄膜の  
製造例

#### 1. Cu薄膜の成長

15 実施例1-1と同様の作製法により、MgO(100)単結晶基板上にCu薄膜を成長さ  
せた。成長したCu薄膜の結晶性をHR-XRDにより評価したところ、MgO(100)基板上  
にCuは(001)配向しており、そのチルト角は0.01度であった。

#### 2. LaCuOS/Cu/MgO積層薄膜の作製

20 MgO(100)単結晶基板上に成長したCu薄膜を基材として、基板温度を室温として  
、パルスレーザー蒸着法(PLD法)により実施例1-2と同じ条件でLaCuOSを堆積さ  
せた。堆積したLaCuOS薄膜はアモルファスであった。

### 3. LaCuOSe/LaCuOS/Cu/MgO積層薄膜の作製

LaCuOS/Cu/MgO積層膜を基材として、基板温度を室温として、LaCuOSeをパルスレーザー蒸着法(PLD法)により、LaCuOSe焼結体をターゲットとして高真空下( $\sim 10^{-5}$ Pa)で堆積した。LaCuOS上に堆積したLaCuOSe薄膜はアモルファスであった。

上記の1. から3. を繰り返し、LaCuOSe/LaCuOS/Cu/MgO積層膜のLaCuOSe膜厚とLaCuOS膜厚の組み合わせが異なる3種類の薄膜を作製した。また、実施例1と同様の方法でLaCuOSeのみ、LaCuOSのみの薄膜を作製した。それぞれの膜厚は下記のとおりである。

(アモルファスLaCuOS膜厚) : (アモルファスLaCuOSe膜厚)

= (200 : 0) 、 (150 : 50) 、 (120 : 80) 、 (60 : 140) 、 (0 : 200)

### 4. LaCuOS<sub>1-x</sub>Se<sub>x</sub> (x=0, 0.25, 0.4, 0.7, 1.0)単結晶薄膜の作製

作製した3種類のLaCuOSe/LaCuOS/Cu/MgO積層膜、LaCuOS/Cu/MgO膜、及びLaCuOSe/Cu/MgO膜とYSZ(100)基板を張り合わせて、蒸気圧の高いCu、S、Se成分の蒸発を抑制するため、LaCuOSおよびLaCuOSe粉末(ともに平均粒径0.1mm, 約1gずつ)と一緒に石英ガラス管に真空封入して、該石英ガラス管を大気中、1000℃で6時間加熱してアニール処理した。加熱処理後は室温まで炉内で冷却した。

### 5. LaCuOS<sub>1-x</sub>Se<sub>x</sub> (x=0, 0.25, 0.4, 0.7, 1.0)単結晶薄膜の結晶性

作製した単結晶薄膜の結晶性は高分解能X線回折(HR-XRD, Rigaku製ATX-G, CuK $\alpha_1$ )を用いて調べた。第5図に、Out-of-plane XRDパターンを示す。LaCuOS<sub>1-x</sub>Se<sub>x</sub> (x=0, 0.25, 0.4, 0.7, 1.0)の(003)面および(004)面の強い回折ピークがMgO(200)ピークとともに観測された。すべてのLaCuOS<sub>1-x</sub>Se<sub>x</sub> (x=0, 0.25, 0.4, 0.7, 1.0)がYSZ(100)上に強く配向していることを示している。またSサイトにSeが固溶するに従

1 つて、結晶のc軸長が伸びたこと(回折位置が低角へシフトしていることと対応する)が分かる。作製した $\text{LaCuOSi}_{1-x}\text{Se}_x$  ( $x=0, 0.25, 0.4, 0.7, 1.0$ ) 薄膜はIn-plane測定からすべてエピタキシャル成長していることが明らかになった。エピタキシャル関係は次の通りである。

5  $\text{LaCuOSi}_{1-x}\text{Se}_x$  ( $x=0, 0.25, 0.4, 0.7, 1.0$ ) (001) //  $\text{MgO}$  (100)

$\text{LaCuOSi}_{1-x}\text{Se}_x$  ( $x=0, 0.25, 0.4, 0.7, 1.0$ ) (110) //  $\text{MgO}$  (110)

6.  $\text{LaCuOSi}_{1-x}\text{Se}_x$  ( $x=0, 0.25, 0.4, 1.0$ ) 単結晶薄膜の発光特性

発光特性を実施例 1 - 5 と同じ手法で評価した。第 6 図に室温の発光スペクトルを示す。励起子由来のシャープな発光が認められた。Se濃度の増加に伴いその  
10 発光波長は長波長側へシフトした。Se置換濃度を厳密に制御することによって、発光波長は室温において390nm( $x=0$ )から430nm( $x=1$ )まで連続的に変化させることが可能である。

すなわち、格子間距離不整合の小さな $\text{MgO}$ (100)基板を用いたときは、本実施例に示した方法により、該基板上へ単結晶 $\text{LaCuOSi}_{1-x}\text{Se}_x$  ( $0 < x < 1$ ) 固溶体薄膜をエピタ  
15 キシャル成長させることができた。

(実施例 4)

格子間距離不整合の大きな基板上への単結晶 $\text{LnCuOX}_{1-x}\text{X}'_x$  ( $X=\text{S}, X'=\text{Se}$ ) 固溶体の製造例

1.  $\text{LaCuOS}$  単結晶薄膜の作製

20 実施例 1 - 1 から 1 - 4 と同様に単結晶 $\text{LaCuOS}$ 薄膜をYSZ(100)上に成長させた。X線反射率測定からその $\text{LaCuOS}$ 薄膜の膜厚は140nmであった。

2.  $\text{LaCuOSe}/\text{LaCuOS}$  積層薄膜の作製

1 単結晶LaCuOSを基材として、基板温度を室温として、PLD法により、LaCuOSe焼結体をターゲットとして高真空下( $\sim 10^{-5}$ Pa)でLaCuOSeを堆積させた。X線反射率測定からLaCuOSe薄膜の膜厚は60nmであった。堆積したLaCuOSe薄膜はアモルファスであった。

5 3. LaCuOS<sub>1-x</sub>Se<sub>x</sub> (x=0.7) 単結晶薄膜の作製

作製したLaCuOSe/LaCuOS/YSZ積層膜2枚の表面同士を張り合わせて、蒸気圧の高いCu、S、Se成分の蒸発を抑制するため、LaCuOS及びLaCuOSe粉末(ともに平均粒径0.1mm, 約1gずつ)と一緒に石英ガラス管に真空封入して、該石英ガラス管を大気中、1000℃で6時間加熱してアニール処理した。加熱処理後は室温まで炉内で  
10 冷却した。

4. LaCuOS<sub>1-x</sub>Se<sub>x</sub> (x=0.7) 単結晶薄膜の結晶性

作製した単結晶薄膜の結晶性は高分解能X線回折(HRXRD, Rigaku製ATX-G, CuK $\alpha_1$ )を用いて調べた。第7図に、Out-of-plane XRDパターンを示す。なお、比較のためLaCuOS単結晶のパターンも掲載した。LaCuOS<sub>1-x</sub>Se<sub>x</sub> (x=0.7)の(003)面の強い回折ピークがYSZ(200)ピークとともに観測された。LaCuOS<sub>1-x</sub>Se<sub>x</sub> (x=0.7)がYSZ  
15 (100)上に強く配向していることを示している。

また、単結晶LaCuOSのパターンとの比較から、サイトにSeが70%固溶したことによって、結晶のc軸長が伸びたこと(回折位置が低角へシフトしていることと対応する)が分かる。ロッキングカーブ測定から、LaCuOS<sub>1-x</sub>Se<sub>x</sub> (x=0.7)の(003)面の  
20 チルト角は0.2度であった。作製したLaCuOS<sub>1-x</sub>Se<sub>x</sub> (x=0.7)薄膜はIn-plane測定からエピタキシャル成長していることが明らかになった。エピタキシャル関係は次の通りである。

1 LaCuOSi<sub>1-x</sub>Se<sub>x</sub> (x=0.7) (001) // YSZ(100)

LaCuOSi<sub>1-x</sub>Se<sub>x</sub> (x=0.7) (110) // YSZ(010)

5 なお、実施例4-1及び4-2において、それぞれの膜厚を変化させることによつて、最終的に得られる置換固溶体の置換量xを0から1.0まで連続的にコントロールすることが可能である。

すなわち、格子間距離不整合の大きなYSZ(100)基板を用いたときは、本実施例に示した方法により、該基板上に、単結晶LaCuOSi<sub>1-x</sub>Se<sub>x</sub> (0<x<1)固溶体薄膜をエピタキシャル成長させることができた。

(比較例1)

10 (通常のPLDを実施した例)

LaCuOS焼結体をターゲットとして用い、H<sub>2</sub>S雰囲気下、基板温度500~900℃で、PLD法によりYSZ(100)単結晶基板上に薄膜を堆積させた。蛍光X線分析による組成分析を行ったところ、La/Cu原子比は基板温度の上昇に伴い増加する傾向を示した。また、膜中のS濃度は基板温度の上昇に伴い減少する傾向を示した。これら  
15 のデータから、基板温度の上昇に伴い、蒸気圧の高いCu、S成分の昇華が起こったと結論できる。作製した薄膜のXRD測定を行ったところ、LaCuOSの単一相のパターンは一切認められなかった。

第8図に、例として基板温度500℃、H<sub>2</sub>S雰囲気下でPLD法により堆積した膜のXRDパターンを示す。LaCuOSのピークのほかにLa<sub>2</sub>O<sub>3</sub>及びLa<sub>2</sub>O<sub>2</sub>Sのピークが観測され  
20 ている。この結果は、膜中のLa濃度がCuと比較して高いという組成分析の結果とも一致する。本比較例から、PLDなどの気相法では、直接的にLnCuOX薄膜を作製することが困難であることが分かる。

1 (比較例 2)

(基材薄膜なしで同様の加熱処理を実施した例)

LaCuOS焼結体をターゲットとして用い、基板温度は室温で、PLD法によりYSZ(100)単結晶基板上に薄膜を堆積させた。得られた薄膜を、実施例 1 - 3 と同様の  
5 手法で真空封入後、1000℃で30分間加熱処理を施した。加熱処理終了後は室温まで炉内で冷却した。作製した膜のHRXRD測定から、作製した薄膜は多結晶単一相のLaCuOSであることが確認できた。この結果から単一相LaCuOS膜は得られるが、  
単結晶LaCuOSではなく、基材とするCu膜がなければ単結晶LaCuOS膜は得られないことを示している。第 9 図に、基材薄膜としてCu薄膜を用いた場合と、用いなか  
1 0 った場合のXRDパターンを示す。

産業上の利用可能性

本発明のLnCuOX単結晶薄膜は、発光ダイオード素子、半導体レーザー素子、電  
界効果型トランジスタ素子、またはヘテロバイポーラトランジスタ素子用単結晶  
1 5 として適する。

1

## 請 求 の 範 囲

5

1. 単結晶基板上に基材薄膜を成長させ、さらにその上に、アモルファス又は多結晶LnCuOX(ただし、Lnは、ランタノイド元素又はYのうち少なくとも1種類、また、Xは、S、Se、又はTeのうち少なくとも1種類を意味する。)薄膜を堆積させた後、真空封入下で500℃以上の高温でアニールすることを特徴とするLnCuOX単結晶薄膜の製造方法。

10

2. 請求の範囲第1項記載の基材薄膜が、Cu、Cu<sub>2</sub>S、CuS、Cu<sub>2</sub>O、CuO、CuCl、CuCl<sub>2</sub>、CuI、Ag、Ag<sub>2</sub>S、Ag<sub>2</sub>O、AgO、AgCl、AgI、Auのいずれかであることを特徴とする請求の範囲第1項記載の単結晶薄膜の製造方法。

15

3. 請求の範囲第1項記載の単結晶基板が、YSZ、Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、STO、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、又はMgOであることを特徴とする請求の範囲第1項記載の単結晶薄膜の製造方法。

4. 請求の範囲第1項記載の基材薄膜として、YSZ(100)、Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(100)又はMgO(100)単結晶基板上に成長したCu薄膜を用いることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の単結晶薄膜の製造方法。

5. LnCuOX蒸気を含む雰囲気でアニールすることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の単結晶薄膜の製造方法。

6. 堆積したLnCuOX膜の表面をYSZ単結晶基板で覆ってから真空封入することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の単結晶薄膜の製造方法。

20

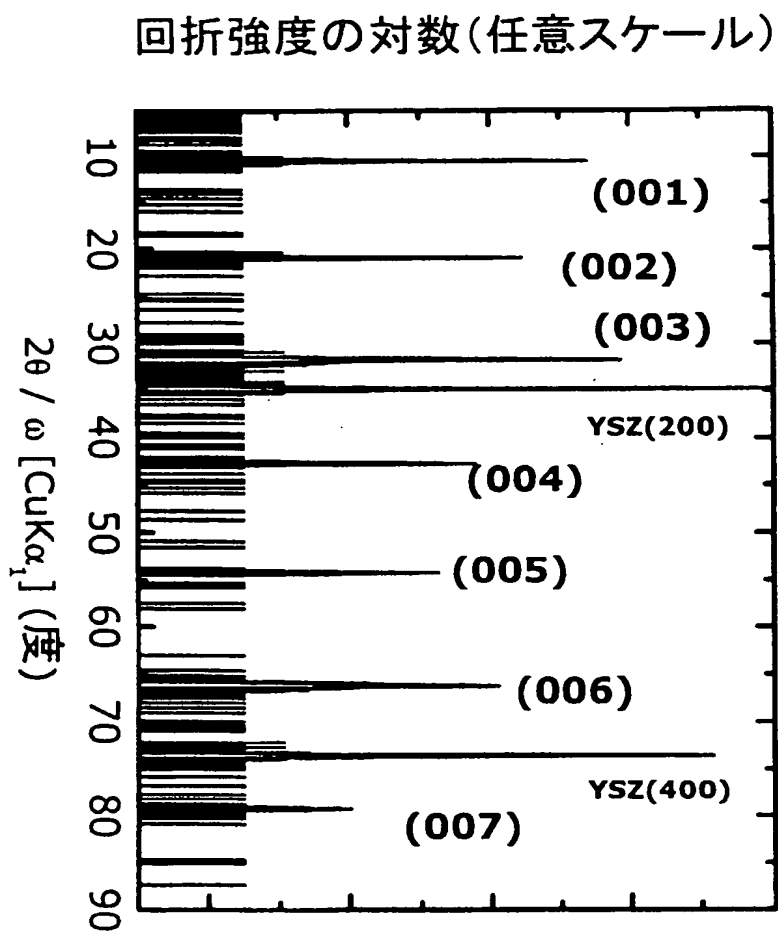
7. 2枚のLnCuOX/基材薄膜/単結晶基板の積層膜、又はLnCuOX/基材薄膜/単結晶基板とLnCuOX/単結晶基板の積層膜の表面同士を張り合わせて、真空封入することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の単結晶薄膜の製造方法。

- 1 8. 請求の範囲第1項から7のいずれかに記載の製造方法で得られたことを特徴とする $\text{LnCuOX}$ (ただし、Lnは、ランタノイド元素又はYのうち少なくとも1種類、また、Xは、S、Se、又はTeのうち少なくとも1種類を意味する)単結晶薄膜。
- 5 9. 請求の範囲第8項記載の $\text{LnCuOX}$ 単結晶薄膜のLnサイトを2価の金属イオンM(ただし、Mは、Mg, Ca, Sr, Ba, Znのうち少なくとも1種類)で置換したことを特徴とする $\text{Ln}_{1-y}\text{MyCuOX}$ (ただし、 $0 < y < 1$ )単結晶薄膜。
- 10 10. 請求の範囲第8項記載の $\text{LnCuOX}$ 単結晶薄膜又は請求の範囲第9項記載の $\text{Ln}_{1-y}\text{MyCuOX}$ 単結晶薄膜を基材とし、さらにその上に $\text{LnCuOX}'$  又は $\text{Ln}_{1-y}\text{MyCuOX}'$  (ただし、Lnは、ランタノイド元素又はYのうち少なくとも1種類、また、XとX' は、S、Se、又はTeのうち少なくとも1種類を意味し、XとX' は異なる元素とする)薄膜を堆積させた後、真空封入下で $500^\circ\text{C}$ 以上の高温でアニールすることを特徴とする単結晶 $\text{LnCuOX}_{1-x}\text{X}'_x$ (ただし、 $0 < x < 1$ ) 固溶体薄膜の製造方法。
- 15 11. 請求の範囲第8項記載の $\text{LnCuOX}$ 単結晶薄膜又は請求の範囲第9項記載の $\text{Ln}_{1-y}\text{MyCuOX}$ 単結晶薄膜を用いることを特徴とする発光ダイオード素子、半導体レーザー素子、電界効果型トランジスタ素子、又はヘテロバイポーラトランジスタ素子。



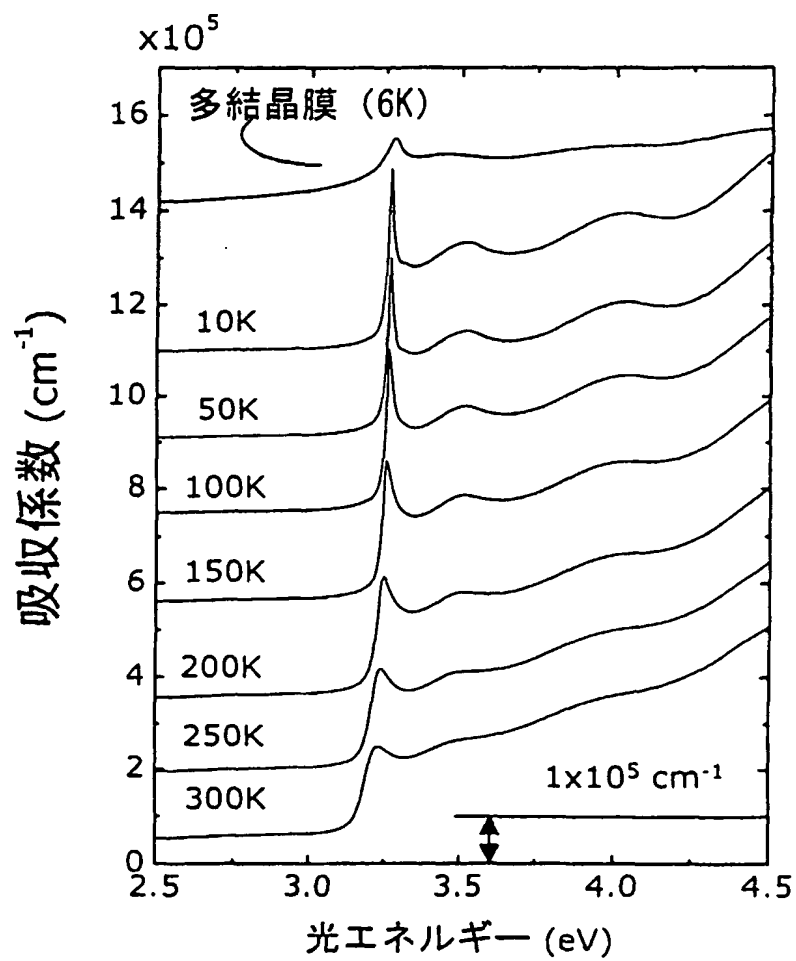
1/7

第1図



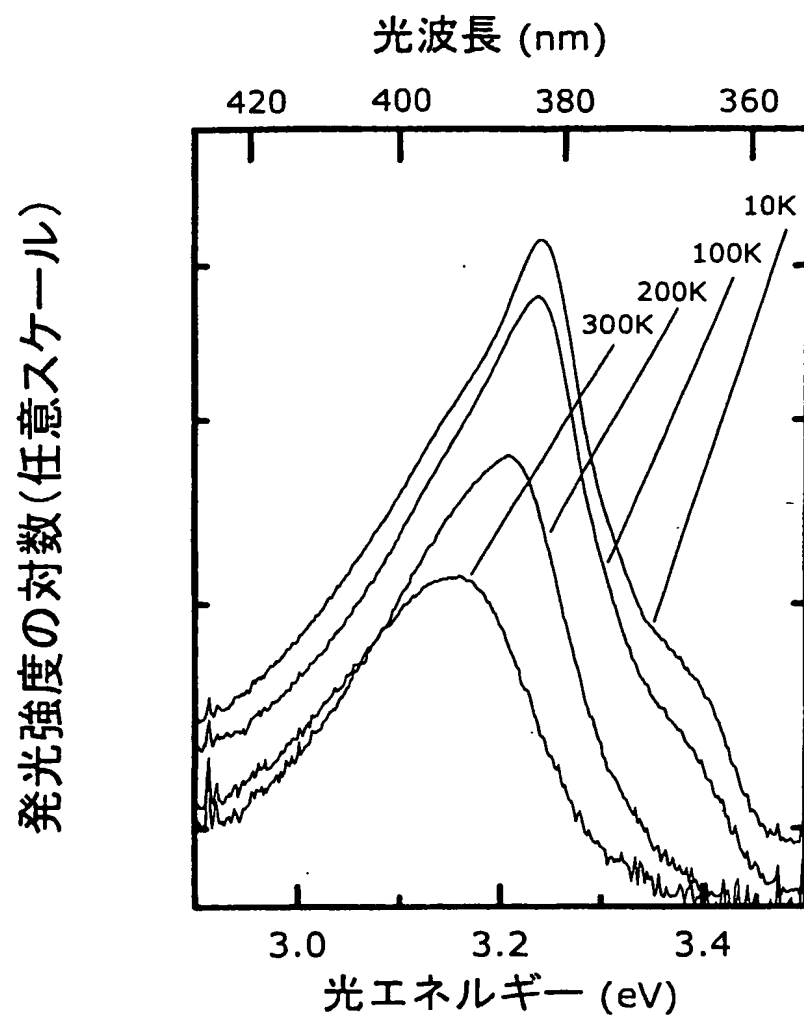
BEST AVAILABLE COPY

第2図

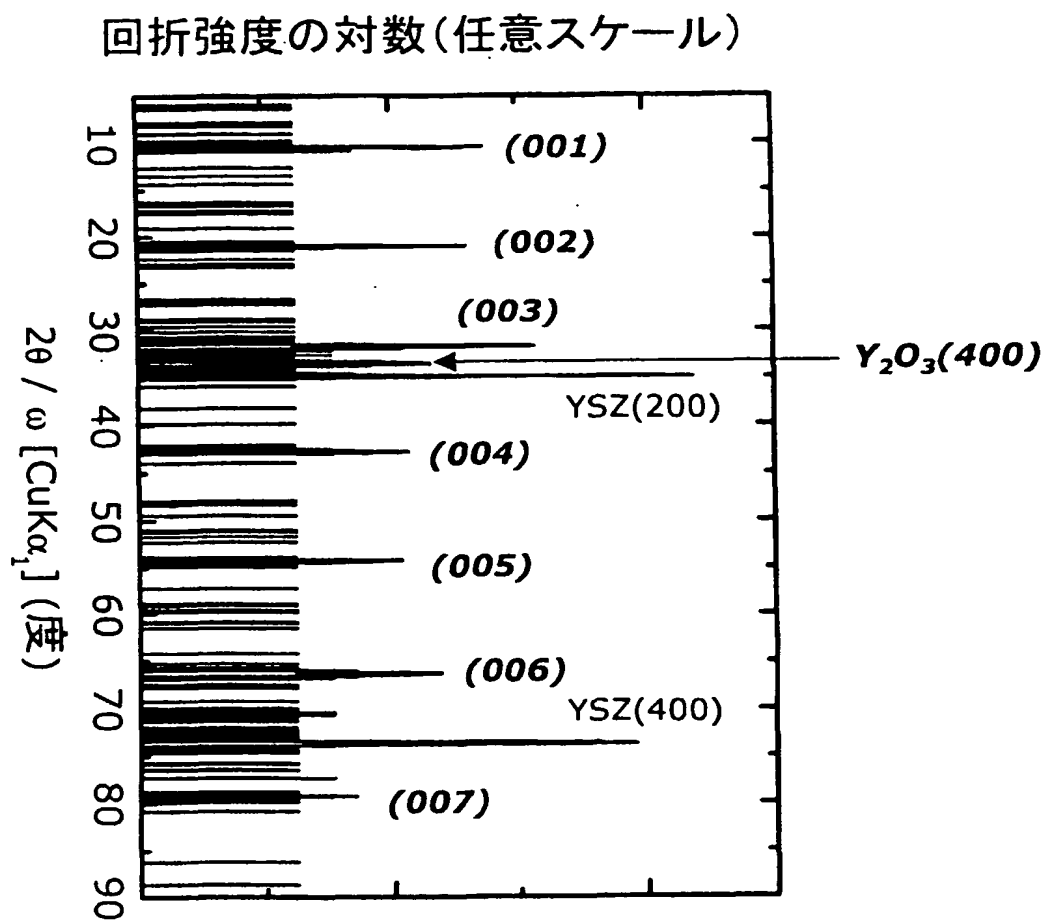


3/7

第3図

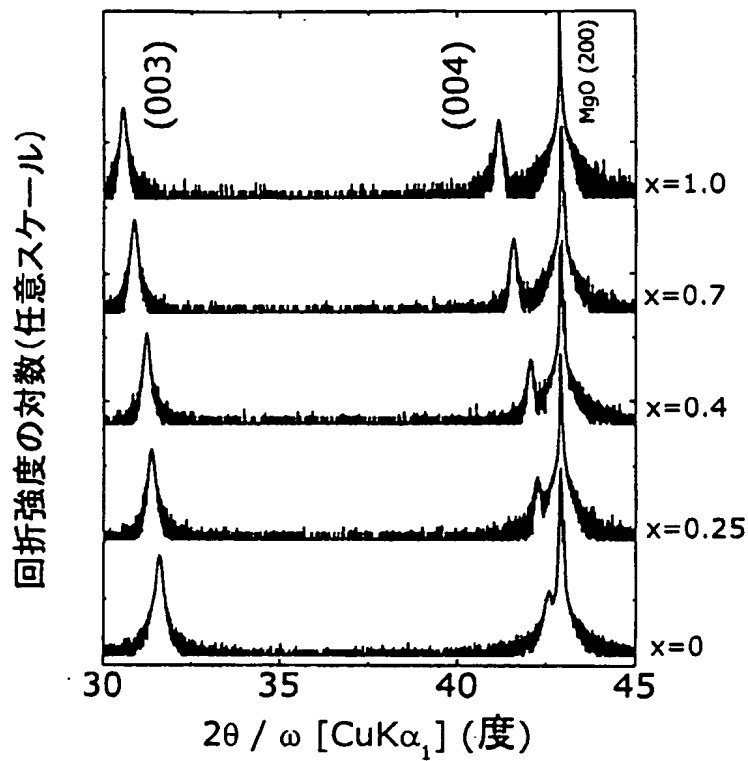


第4図

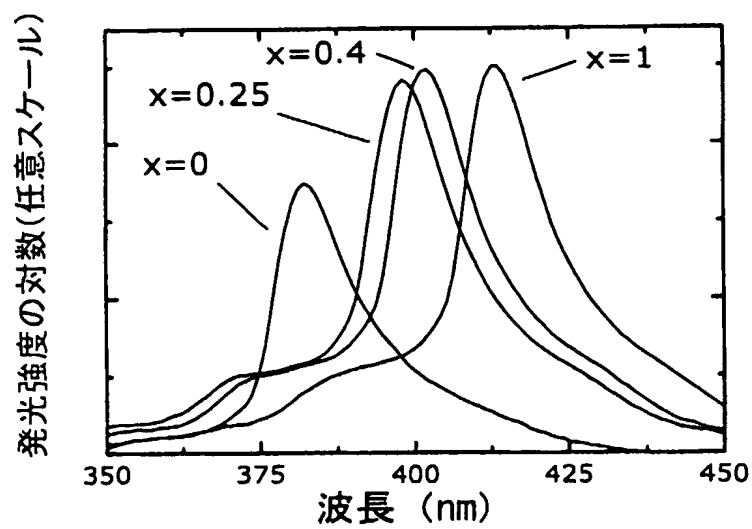


5/7

第5図



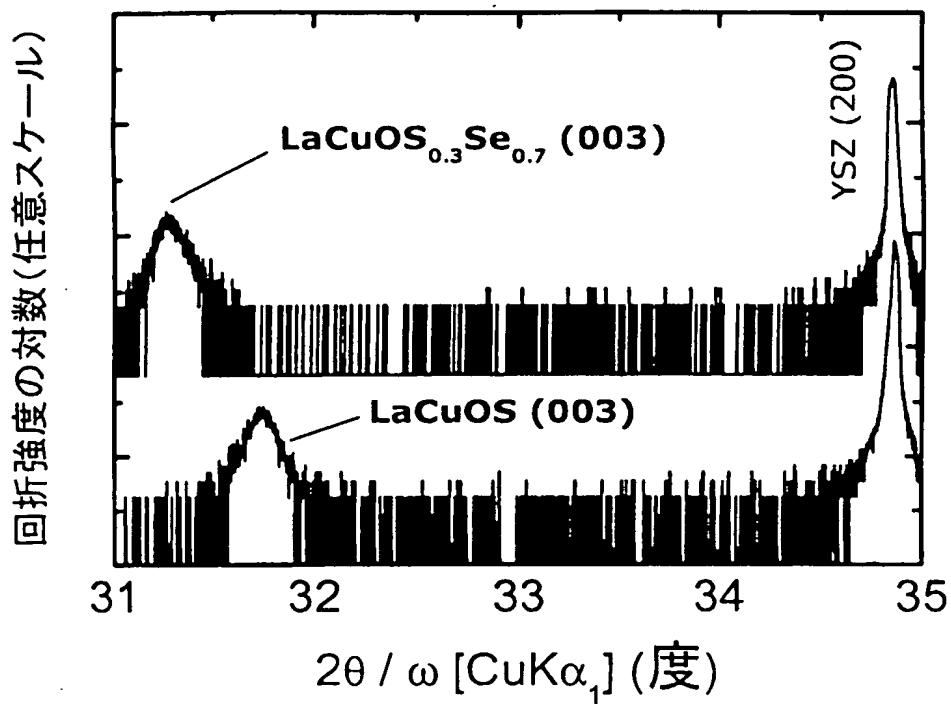
第6図



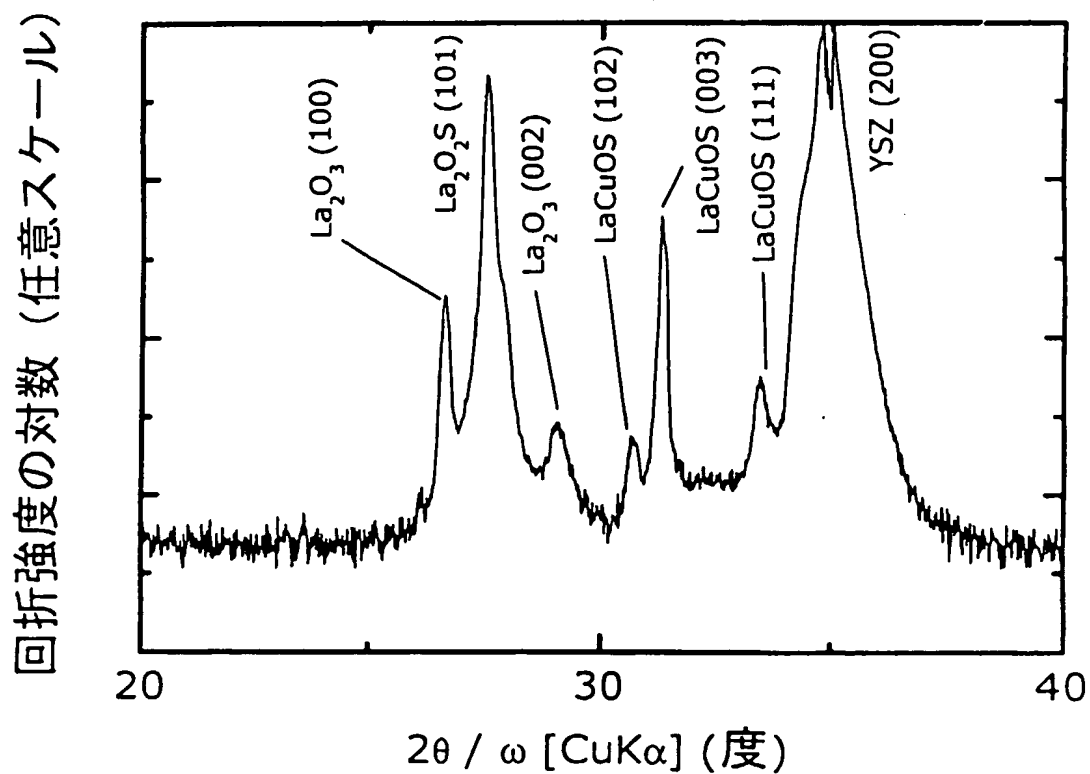
BEST AVAILABLE COPY

6/7

第 7 図



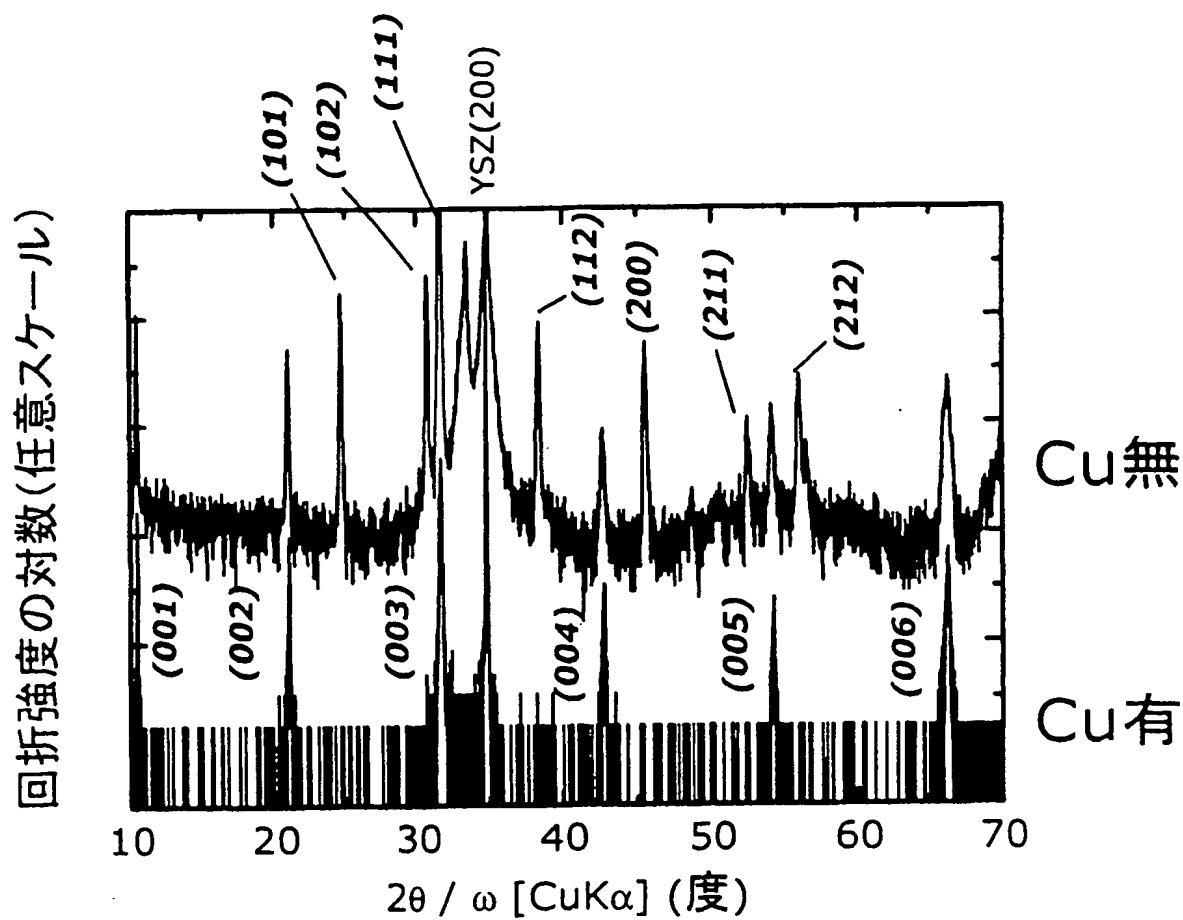
第 8 図



BEST AVAILABLE COPY

7/7

第9図



BEST AVAILABLE COPY

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/01756

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl<sup>7</sup> H01L21/363, 33/00, C30B29/22

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl<sup>7</sup> H01L21/36, 21/363, 33/00, C30B29/22, C23C14/00-14/58

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2003
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2003	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2003

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P,A	JP 2002-80222 A (Zaidan Hojin Rikagaku Shinkokai), 19 March, 2002 (19.03.02), Full text (Family: none)	1-11
P,X	Hidenori HIRAMATSU, "Wide-gap p-gata Handotai LaCuOS no Epitaxial Seicho to Kobutsusei", Dai 49 Kai Oyo Butsurigaku Kankei Rengo Koenkai Koen Yokoshu, 27 March, 2002 (27.03.02), No.2, page 629	1-11
A	K. UEDA, "Room-temperature excitons in wide-gap layered-oxysulfide semiconductor: LaCuOS', Appl. Phys.Lett., 16 April, 2001 (16.04.01), Vol.78, No.16, pages 2333 to 2335	1-11

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
24 April, 2003 (24.04.03)

Date of mailing of the international search report  
13 May, 2003 (13.05.03)

Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.



**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

International application No.

PCT/JP03/01756

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	K. UEDA, "Transparent p-type semiconductor: LaCuOS layered oxysulfide", Appl.Phys.Lett., 23 October, 2000 (23.10.00), Vol.77, No.17, pages 2701 to 2703	1-11

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>1</sup> H01L 21/363, 33/00, C30B 29/22

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>1</sup> H01L 21/36, 21/363, 33/00, C30B 29/22, C23C 14/00-14/58

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年  
 日本国公開実用新案公報 1971-2003年  
 日本国登録実用新案公報 1994-2003年  
 日本国実用新案登録公報 1996-2003年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
P, A	JP 2002-80222 A (財団法人理化学振興会) 2002. 03. 19, 全文 (ファミリーなし)	1-11
P, X	平松秀典, ワイドギャップp型半導体LaCuOSのエピタキシャル成長と光物性, 第49回応用物理学関係連合講演会講演予稿集, 2002. 03. 27, No. 2, p. 629	1-11
A	K. UEDA, 'Room-temperature excitons in wide-gap layered-oxysulfide semiconductor: LaCuOS', Appl. Phys. Lett., 2001. 04. 16, Vol. 78, NO. 16, p. 2333-2335	1-11

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの  
 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの  
 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)  
 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献  
 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの  
 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの  
 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの  
 「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

24. 04. 03

国際調査報告の発送日

13.05.03

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)  
 郵便番号100-8915  
 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

酒井 英夫

4R

9631

電話番号 03-3581-1101 内線 3469

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	K. UEDA, 'Transparent p-type semiconductor: LaCuOS layered oxysulfide', Appl. Phys. Lett., 2000.10.23, Vol. 77, NO. 17, p. 2701-2703	1 - 1 1